This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

02564491 **Image available** SEMICONDUCTOR LASER Pub. No.: 63-181391 [JP 63181391 A]

Published: July 26, 1988 (19880726)

Inventor: KUWAMURA YUJI

Applicant: NEC CORP [000423] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

Application No.: 62-013006 [JP 8713006]

Filed: January 21, 1987 (19870121)

INTL CLASS: International Class: 4 J H01S-003/18

JAPIO Class: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO Keyword: R002 (LASERS); R095 (ELECTRONIC MATERIALS -- Semiconductor Mixed Crystals)

Ioumal: Section: E, Section No. 688, Vol. 12, No. 457, Pg. 29, November 30, 1988 (19881130)

RSTRAC

spectral line width by a method wherein a superlattice structure subjected to modulation doping is adopted as a structure of an PURPOSE: To obtain a semiconductor laser having excellent high-speed modulation characteristics and a narrow oscillation active layer and a high-resistance layer is used as a current constricting structure.

SiO(sub 2) film 16 is grown, part 17 of the film 16 is removed, Zn is diffused up to a region 9 including at least the active layer film 13 as a mask, an n-type InP layer 8 is selectively grown using the film 13 as a mask and the film 13 is removed. Then, an and part 12 of the ohmic layer 7 is etched away. Then, after an Si nitride film 13 is grown, part 14 thereof is etched away and thereafter, a semiconductor crystal region 15 including at least the superlattice structure active layer is etched away using the formed by growing alternately a p-type or n-type InP barrier layer and a non-doped InGaAs well layer, a high-resistance InP CONSTITUTION: A high-resistance InP clad layer 2, a superlattice structure active layer 3 subjected to modulation doping clad layer 6 and a p-type InGaAsP ohmic layer 7 are grown by crystallization in order on a high-resistance InP substrate 1 3 using the film 16 as a mask and a p side electrode 11 and an n side electrode 10 are formed

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭62-181391

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

③公開 昭和62年(1987)8月8日

C 10 C 3/02

6683-4H 6683-4H

審查請求 有 発明の数 1 (全15頁)

光学的異方性炭素質ピッチの製造法 の発明の名称

> ②特 昭61-203967

29出 昭55(1980)11月19日 頭

砂特 願 昭55-162572の分割

勿発 明 者 泉

埼玉県入間郡大井町大字亀久保字立帰1906-7番地

79発 明 者 内 藤

勉 雄 埼玉県入間郡鶴ケ島町大字脚折字八幡591-4番地

明 村 73発 者 中 知 坂戸市伊豆ノ山町17-31

東亜燃料工業株式会社 顖 ②出

弁理士 倉 橋

東京都千代田区一ッ橋1丁目1番1号

1. 范明の名称

何代 理

光学的異方性炭素質ピッチの製造法

2. 特許請求の範囲

1) ピッチ製造用設料を熱分解重縮合することに より部分的に光学的異方性相を生成させ、当該光 学的異方性相を分子最を増大させることの少ない 温度で沈積して分離した後、これを熱処理するこ とを特徴とする約90%以上の光学的異方性相を 含有する光学的異方性炭素質ピッチの製造法。

2) ピッチ製造用原料として重質 炭 化水素油、タ - ル又はピッチを使用する特許請求の韓四年1項 記載の光学的異方性皮素質ピッチの製造法。

3) ピッチ製造用原料を約380℃以上の温度で 熱分解重縮合に供し、重縮合物中の光学的異方性 相が約20%~約80%生成したとき当該近路台 物を約400℃以下に保持しつつ下層を分離し、

分離された下層をさらに約380℃以上で熱処理

し、約90%以上の光学的異方性相を含有する特 許請求の範囲 第1 項記 盆の光学 的 異 方性光学 的 異 方性皮葉質ピッチの製造法。

4) 热分解近期合を約400℃~約440℃で行 なう特許請求の範囲第3項記載の光学的異方性決 **業費ピッチの製造法。**

5)約400℃以下に保持しつつ分離した下層の 光学的異方性相の含有量が約70%~約90%で ある特許請求の範囲第3項記載の光学的異方性炭 要買ピッチの製造法。

6) 熱処理を約390℃~約440℃で行なう特 許請求の範囲第3項記載の光学的異方性決案質ピ ッチの製造法。

明細告の存む(内容に変更なし) 3頁~ だ 負

3 . 発明の詳細な説明

本角明は、高速度および高強性収を有する误楽 概維およびその他の误案材料を含む误楽材を製造 するために適した光学的異方性误楽質ピッチを製造する方法に関するものである。

今後の省エネルギー、省質額時代に航空機、自動車その他に必要な軽量かつ高強度、高外性の複合材料の素材を構成する低コストの高性能炭素繊維か、または、加圧成形して積々の用途に使用される高強度、高密度の成形炭素材料が強く要望されている。

従来高性能決審機能の製造のために適した光学的異力性ピッチの組成および構造について十分な別示はなく、決決質ピッチ物質の物性とその組成および概略の構造との関係については、従来、不明瞭であつてこれを工業的規模で安定に制御して得られる技術は未だ完成されていない。

従来、 別示されている光学的 異方性 ピッチ例えば、 特別 昭 4 9 - 1 9 1 2 7 号、 特別 昭 5 0 - 8 9 6 3 5 号公 根に記載されている光学的異方性ピ

更に、特別的54-55625号公银で明示されているピッチ物質は、実質上1009%の光学的異方性相から成る均質ピッチであるが、分子能分布がかなり狭く、後で更に詳しく説明されるが未発明の光学的異方性ピッチの重要な組成分であるニーヘブタン可容成分(以下「0成分」という)

ッチは、光学的異方性相部分が、ほぼ、キノリン不常分(またはピリジン不常分)に相当し、光学的異方性相部分を100%に近づけると、軟化点が著しく上昇し、紡糸温度が400℃の近傍またはそれ以上となり、紡糸時にピッチの分解ガスの発生及び重合が遊起することから、従来の皮素繊維紡糸法は、光学的異方性相部分の含有量を90%以下、好ましくは、50%~65%に抑えて紡糸温度を熱分解及び熱重合が顕著に生じない温度に抑える方法を採用している。

しかしながら、このようなピッチ組成物は、光学的異力性相と相当量の光学的等方性相の混合物であるため不均質なピッチであり、紡糸時に糸切れが多いこと、繊維の太さが不均一になること、または繊維の強度が低いという難点を包蔵するものである。

また、特公昭49~8634号公根で明示されているピッチ物質は、光学的異方性相が契負的に100%のようにも見うけられるが、ピッチ分子の化学構造を特定化した特殊のピッチであつて、

と、 n - ヘブタン不能且つベンゼン可能の成分 (以下「A 成分」という)の含有量が少なく、 更 に他の残余のベンゼン不能成分中のキノリン可能 成分 (以下「B 成分」という。)及びキノリン不 が成分 (以下「C 成分」という)の含有量が比較 的多いため、その総合的な結果として該従来のピ ッチ物質の軟化点は、約330℃以上であり、紡 糸温度は、380℃~400℃以上に速すること になり、この温度範囲では、工業的に安定と ッチを紡糸することは依然困難を伴うものである。

以上述べた如く、従来知られている光学的異方性相が100%に近い均質な光学的異方性ピッチは、いずれも軟化点が高く、安定した紡糸が困難であり、一方、軟化点の低いピッチは、特殊な出のでは料から製造した特殊な組成構造を有するもの以外は、不均質であり、同様に紡糸が困難であって、この結果、品質の低れた決楽組織を製造することは進事である。

* また、従来、一般に、光学的異方性ピッチを紹

本発明者らは、高性能炭素繊維を製造するために適した光学的男力性ピッチ組成物について様々検討したところ、光学的異方性ピッチは、縮合多環労香族の積層構造の発達した分子配向性の良いピッチであるが、実際には種々のものが混在し、そのうち、軟化点が低く、均質な炭素繊維の製造

現方性相を含有し、高強度、高弾性率の炭素材、特に、炭素繊維を製造するのに適した光学的異方性相ピッチであつて、かつ、低軟化点を有する光学的異方性炭素質ピッチを効率よく製造する方法を提供することである。

本発明の他の目的は、特に上述した如き特定の 組成、構造及び分子位を持つた〇成分、A成分、 B成分及びC成分から成る高強度、高弾性率の炭 素材の製造に適した光学的異方性炭素質ピッチの 製造法を提供することである。

上記本発明の諸目的は本発明に係る光学的異方性と異質ピッチの製造法にて達成される。要約すれば、本発明は、ピッチ製造用飲料を熱分解取留合することにより部分的に光学の異方性相を分子量を増大させることの少ない温度で沈積して分離した後、これを熱処理することを特徴とする約90%以上の光学的異方性相を含みする光学的異方性皮質ピッチの製造法である。

本苑明について以下に里に詳しく説明する。

に選したものは特定の化学構造と組成を有いて、 と、すなわち、光学的異方性ピッチにおい、及びの 記したの成分即ちゅーへブタンが群且のであることである。 の知成、構造、分子量が構めてであることが 分の組成したのである。更に詳えば物がとと 及びA成分を特定サるではピッチは な光学的異方性ピッチを切に調整することが高異 でで表現れるであるための光学的 な光学の構成バランスを適切に調整することが に設置材料を実用的に製造するための光学の 性ピッチ組成物の必須の条件であることを見出 た。

更に又ピッチ組成物中の前記O成分及びA成分以外の残余のベンゼン不溶成分であるキノリン可溶成分(以下「B成分」という)と、キノリン不溶成分(以下「C成分」という)を特定することにより、更に優れた高性能変素材料を製造するための光学的異方性ピッチが提供されることが分つた。

木苑明の主たる目的は、約90%以上の光学的

すなわち、木発明によれば、限定されるものではないが特に必須成分として O 成 分を約 2 重 3 %~約 2 0 重 5 % 4 5 重 5 % 6 4 し、 残余の成分は ベンゼン不 お分であり、 光学的異方性 相の 体積合 有率が約 9 0 %以上であり、約320℃以下の飲 化点を有することを特徴とする上述の 如き 炭素材料、特に皮 深級維の製造用炭素質 ピッチを好適に 製造し得る。

本発明者らの知見によると、従来技術により製造せられた光学的異方性ピッチにおいてはキノリン不溶成分(又はピリジン不溶成分)のみが主要成分であるか、又はベンゼン不溶分(B成分及び及びなの合す量が少ないために、又はそれらの特性が不適正なために妥当でなく、更に完明した結果前述の如く或る特性のO成分及びA成分が特定最存在することが当該ピッチ組成にとつて不可欠であることが明らかとなった。

木 危 明 は、 種 々 の 光 学 的 異 方 性 ピッチ を 調 製 し、 宿 削 分 種 に よ り こ れ ら 皮 楽 質 ピッチ より O 皮

分およびA並分を分別し、各成分の個々の特性お よび当該特性を有する各成分の含有量とピッチ金 体の物性、均質性、配向性等との関係について詳 しく検討した結果に基き完成したものであり、こ れは、各岐分が従来技術では認められたかつた箱 囲の特定量合有され、かつ、各成分が特定の性状 を有するものであることが重要であることを見出 したことに基因するものである。すなわち、高性 能误器繊維の製造に必要な高配向性、 均質性およ び低軟化点を有し、低温で安定した溶融紡糸の可 能な光学的異方性ピッチの構成成分の性状として はC/H原子比、fa、数平均分子型、最高分子 量(低分子量側から99%種質した点の分子量) および 放低分子量 (高分子量側から99% 植算し た点の分子量)が以下に述べる如き範囲に特定さ れたものである。

〇成分は、一般的には広範囲の特性のものがあるが、本発明においては、約1.3以上のC/H原子比、約0.80以上のfaおよび約1.00 0以下の数平均分子量および約1.50以上の最小

本発明者が更に検討したところ、前記O成分及びA成分は光学的異方性ピッチ中において抗層構造中に取り込まれ、新媒的または可塑剤的な作用をし、主にピッチの新維性、旋動性に関与し、それ自体単独では抗層構造を発現しにくく光学的異方性を示さない成分であるが、更に残余成分であ

分子量を有するものであり、好ましいC/H 原子比は、約1、3~1、6、f a は、約0、80~約0、95であり、数平均分子量は、約250~約700、破小分子量は約150以上である。

また、A 成分は、一般的には広範囲の特性のものがあるが、本范明においては約1、4以上ののC / H 原子比、約0、80以上の f a、約2、000以下の数平均分子及および約10、000以下の放平均分子及おり、好ましかし、好ました。4~約1、7、 f a は約0、80~約0、95、 数平均分子及は約400~約1、000、 最高分子及は約5。000以下のある。 さらに、各成分の、好適な合行及は、00分にのかって約15重量%~約45重量%であり、A 成分は、約15重量%~約35重量%である。

すなわち、 O 成分の C / H 原子比及び f a が前述の範囲より小さい場合と含有事が前述の範囲よ

りそれ日体単独では溶性せず疑問容易な成分であるベンゼン不容のB成分及びC成分を前記O成分及びA成分に対しその構成成分が特定の範囲内の構成比。の化学構造特性分子量が特定の範囲内に存在するならば一層、仮れた均質で低軟化点の高性低炭素繊維を製造するために必要な光学的異方性にッチが得られることも見出した。

すなわち、○成分を約2重显%~約20重显% およびA成分を約15重量%~約45重量%を含 打し、さらに、B成分(ベンゼン不溶キノリン 溶成分)を約5重量%~約40重量% 分(ベンゼン不溶キノリン不溶成分)を約20重 分(ベンゼン不溶キノリン不溶成分)を約20重 の含有取が体積で約90%以上であり、飲化点が 約320℃以下の光学的異方性炭素質ピッチは 後述の如き一層安定した高性能の炭素繊維を提供 することができる。

上記B成分及びC成分に関して、高性能误案機能の製造に必要な高配向性、均質性および低軟化

点を有し、低温で安定した解離紡糸の可能な光学的異方性ピッチの構成成分の好ましい性状としてはC/H原子比、fa. 数平均分子量、最高分子量(低分子量側から99%發揮した点の分子量)が以下に述べる如き範囲に特定されたものである。

すなわち、B成分(ベンゼン不溶、キノリン可称分)は、一般には非常に広範囲の特性のものがあるが、好ましい性状としては、約1.5以上ののC/H以子比、約0.80以上のfa、約2,000以下の数平均分子度および約10,000以下の放高分子量を有するものであり、好まは約0.80~約2,000であり、C 成分(ベンゼがののであり)は、これも一般的には非としいをあるがあるが好ましい性状とのでは、約2.3以下のC/H以子比、約0.85以出いのでは、約2.3以下のC/H以子比、約0.85以出いのである。

いので、本明細書では、「光学的異方性相」とは、ピッチ構成成分の一つであり、常温近くで超化したピッチ塊の断面を研摩し、反射型傷光顕微鏡で直交ニコルを回転して光輝が認められるすなわち光学的異方性である部分を意味し、光輝が認められない、すなわち光学的等方性相である部分は光学的等方性と呼ぶ。

のであり、好ましい C / H 駅子比は、約1.8~約2.3であり、f a は、約0.85~約0.95であり、数平均分子量は約1.500~約3,000のものである。

四成分の合有量については、日成分は約5重量
%~約55重量%であり、好ましい含有量は、約
5重量%~約40重量%である。C成分の含有量は、約20重量%~約70重量%であり、好ましい合有量は、約25重量%~約65重量%である。

高性能の安楽線線を提供する好ましい光学的異力性皮素質ピッチの悪様は、前述の如く、皮素質ピッチの機はは、前述の如く、皮素質ピッチの構成成分たる4成分が特定の特性値を有し、特定の組成比で含有することである。以下、水免明に従った製造方法にて極めて好適に製造される上記光学的異方性皮素質ピッチを便宜上まとめて説明する。

本明細労で使用される「光学的異方性相」という語句の意味は、必ずしも学界または種々の技術 文献において統一して用いられているとは含い健

ピッチの均質性に関して、本発明に従って製造したピッチでは上述の光学的異方性相の測定結果が90~1004年級%の間にあり、反射型顕微鏡似系でピッチ断面に固形柱子(柱径1μ以上)を災質上検出せず、溶機紡糸温度で揮発物による発泡が実質上ないものが、実際の溶験紡糸において良好な均質性を示すのでこのようなものを実質上均質な光学的異方性ピッチと呼ぶ。

 斑となる。

大苑明でいう、ピッチの軟化点とは、ピッチが 個体から液体の間を転移する温度をいうが、意動。 走在型熱量計を用いてピッチの避解又は凝固する **帯然の吸放出のピーク温度で測定する。この温度** はピッチ試料について他のリングアンドポール 法、敬量融点法などで測定したものと±10℃の 延囲で一致する。 水発明でいう低軟化点とは、2 30~320℃の範囲の軟化点を意味する。軟化 点はピッチの溶性紡糸温度と密接な関係があり、 ピッチによる違いはあるが通常の紡糸法で紡糸す る場合、一般に飲化点より60~100℃高い温 度が紡糸に適した後動性を示す温度である。従つ て、320℃より高い軟化点の場合、熱分解圧縮 合が起る380℃より高い温度となるため、分解 ガスの発生および不顧物の生成により紡糸性が狙 異されることはいうまでもなく、 紡糸したピツチ 機維に気泡や間形異物を含有し欠陥の原因とな る。 - ガ 2 3 0 ℃以下の低い 飲化点の場合、不融 化処理工程において低温で及時間処理が必要にな

るとか 複雑で 高価な処理が必要となり好ましくない。

水危明でいうピッチ構成成分O成分、 A 成分、 B成分、C成分とは、粉末ピッチをluの平均孔 径を打する円筒フィルターに入れ、ソツクスレー 抽出器を用いてn-ヘブタンで20時間熱抽出し て得られるnーヘブタン可溶分をO成分、ひきつ づきベンゼンで20時間熱抽出して得られるn-ヘプタン不称でベンゼン可称分をA成分、ベンゼ ン不裕分をキノリンを溶剤として遠心分離法(J K-2425) により分雄して得られるべ ンゼン不溶でキノリン可溶分いわゆるβ-レジン を日成分、キノリン不裕分をC成分と呼ぶ。この ような構成成分の分別は例えば石油学会誌20巻 (1)、 第45頁(1977年) に記載の方法に より行なうことができる。ある出発原料から作つ たピッチ構成成分O成分、A成分、B成分、C成 分ではピッチの特性値であるC/H原子比、 a、数平均分子量、最低および最高分子量はいず れも〇成分<A成分<C成分の順に大きくなるの

が一般的である。

A成分は、O成分とB成分の間の分子の平面構造性と、分子巨大さを有する成分でO成分と同じくそれ自体推測では核燈構造を発現し難く、光学的異力性を示さないが、O成分及び重質部分と対して溶媒的に作用する性質を有し、高配向性を扱わないで重質部分と共存して配向性を設わす特性を有するが主にピッチの可塑性及び溶機性に関与する成分である。

B成分は、A成分とC成分の間の分子の平面構造性と分子の巨大さを有する成分で、それ自体単独では総合多環方存族の基層構造の形成や光学的異方性は小さく軟化点も 4 0 0 で以上にあるので、それ自体単独では高温に加熱しても溶験しないで误化するが、O成分、A成分と相溶することにより、溶験性をもちそれがさらにC成分に対して溶媒的に作用する性質を有しC成分と共存して下にピッチの高配向性に関与する成分である。

C 成分は、ピッチ構成成分中最も大きい分子平 前構造性と分子量の巨大さを有する成分で、光学 的異方性ピッチの什格となる紹合多環芳香族の積 層構造を形成し光学的異方性を発現し易いが、B 一成分と同じく軟化点が400℃以上にあるのでそれ自体単独では高温で加熱しても解棄しないで戻 化するが、O 成分、A 成分、B 成分と相称するこ とにより解棄性可塑性をもち、ピッチの高配向性 に関与する成分である。

このように光学的異方性ピッチは、他の成分と相称し生にピッチの配向性に関与する成分と他の

成分に対して溶媒的に作用し、配向性を損わずに とにピッチの溶験性に関与する成分から成り立つ ており、いずれの成分も重要であり、とりわけ篇 性能炭素繊維製造用の高配向性で均貨な低い軟化 点を行する光学的異方性ピッチにおいては、構成 成分の構造特性とそのような特性を有する構成は 分の合有量のバランスが重要である。すなわち、 あまりにもB波分とC波分が多位に含有され相対 的にA成分とO成分の含有が少ないピッチは確か に分子配向性が発現し、全体が光学的異方性とな つても、軟化点が高く紡糸が困難となり、極端な 場合は全く溶融しない。他方、 O 成分、 A 成分を 多く、相対的にC成分、B成分を少なくすると、 飲化点が低くなり、350℃付近で紡糸のために 十分な液体流動性を得ることは容易であるが、分 子配向性の優れたピッチ部分、すなわち光学的異 万性ピッチ部分と、分子配向性の小さい等方性ピ ッチ部分とが二相に分かれた不均質なピッチとな りこれも前述の如く紡糸が困難である。

このように、従来から光学的異方性ピッチの主

量、分子量分布、fa、C/H原子比が最も適切な指標となる。

まず、ピッチの分子配向性すなわち光学的異方性の危現傾向は、ピッチ構成成分の分子の平面構造性および、ある温度での液体能動性と相関がある。すなわちピッチ分子の平面構造部分である組合多環芳香族構造がより発達し、分子量が適度の大きさであるとき、平面状分子が相互に抵肝会合しやすく、同時に溶験状態で分子の再配列が十分よく行なわれ、光学的異方性ピッチが得られる。

ここで、ピッチ分子の平面構造性は、多環芳香族の紹介環の大きさ、ナフテン環合有の数、偶須の数と及さにより決まるから、分子の平面構造性は、と人田原子比、および、芳香族構造が少なの企炭素原子に対する比率)でほぼよわすことができる。すなたの中のナフテン環構造が少ないほど、また側類の数と及さが小さいほど、ピッチ分子の平面構造性は及く、また一般にその傾向に従つてC/H原子

要構成成分として必められていたC成分の他に、 B成分、特に従来ほとんど認識されていなかった O成分とA成分の存在が、高性能误表級維用ピッチの構成成分としては重要である。

また、みかけと構成成分の比率が同じであってもそれぞれの成分の構造特性によってピッチの特性が影響されることは、いうまでもなく、例えばあまりにも分子量の大きい、または分子平面構造性の劣るB成分やC成分を含有する場合は、極めて軟化点の高いピッチとなるし、他方、あまりにも分子量の小さいO成分を含有するときは、ピッチの軟化点は低くなっても、全体の均質性が失われる。

次に、高性能決議維維製造用ピッチの分子配向性、均質性または相称性および軟化点とピッチの構成成分の特性値との関係を詳しく説明する。いうまでもなく、ピッチの如き複雑な混合物については厳密には個々の構成成分分子の構造は、検出も考別もできないので構造特性については前述のように分別した構成成分それぞれの平均的分子

比は大きく、「もも大きくなる。分子の平面構造作を大きくする観点だけからいえば分子をはつの依依流動性は、分子間の相互運動の自由さによつの後次ると考えられるから、それは、ピッチ分子に反大さすなわち数平均分子をと分子をあたまさ)と、分子の平面構造性を均分子をもってとができる。すなわち数でのではないできる。すなわち数でのではないできる。では、後でのでは、ないでは、ないでは、できないでは、できる。では、ためでは、ないである。

次に光学的異方性ピッチの均質性は、ピッチ構成成分の相称性ともいえるが、それは、ピッチ構成成分分子の化学構造の類似性および、ある程度での液体流効性と相関があると推定される。 すなわちピッチ構成成分分子が相互に化学構造形態および分子量分布の点であまりかけ離れたものでないとき相互に現和性、溶解性があり、それぞれがある温度でトクな液体流効性を有するとき、相互

に流動器密して無力学的に安定的に均質なピッチとなる。 従って、光学的異方性ピッチの均質性は、構成成分それぞれのC/耳原子比、faが十分大きく極度に小さい分子量のものを含まず、数平均分子量、 最高分子量が十分小さく、かつ、それらが相互にあまりかけ離れていないことによって実現されると考えられる。

次に光学的異方性ピッチの軟化点はピッチが周体から液体の間を転移する温度を意味することから、これは、前途のある温度のピッチの液体変動性と良い相関がある。従つて、光学的異方性ピッチの軟化点は、構成成分それぞれのC/H原子比、faが適度に大きく、平均分子量が十分小さく、特に最高分子量が小さいことによつて低くなるものである。

以上を総合すると、分子配向性の優れた、均質な、低軟化点の、光学的異方性ピッチを得るためには、C/日賦子比とfaが十分大きく、かつ、それらが構成成分間で類似していて、平均分子並は平面分子の配向性を発現するよう十分に大きい

比率の好ましい範囲について特に、B成分及びC 成分について詳しく具体的に説明する。

まず O 成分は、まだ分子最もあまり大きくはなく、 方香族構造も、 他の成分ほど十分に発達していない。 一般に C / H 原子比が1. 6 以下、 f a が 0 . 9 5 以下、 数平均分子量が1. 0 0 0 以下の油状物質であるが、 光学的異方性ピッチの中に合有されて、その分子配向性を扱わず、全成分に対して溶媒ないしは可型剤的役割をする重要な成分である。

A 成分は、構造等性および分子量としては、一般に O 成分と B 成分の中間に位置するものであり、 O 成分よりもや、分子配向性への容牙が大きいと推定され、かつ O 成分と共に相称して、 B 成分、 C 成分に対する新削又は可想制的な役割をすると考えられ、これも、 低軟化点の均質な光学的 男 万性 ピッチ の 形成に 不可欠 な構成 成分である。

B 成分は、構造特性値および分子量が一般に A 成分と C 成分の中間に位置するものであり、 O 成

が、低軟化点のためには、それがあまり大きすぎ ないこと、特に放高分子量があまり大きなものを 含まないこと、また、ピッチの均質性の風点か ら、根腹に低分子質の成分を含まないことも要作 であることが理解されよう。このようなピッチ は、大量安価に入手できる石油や石炭工業から産 出される正貫油やタール物質を出発原料にする場 合は、出発原料の分子構造が多様であり、分子量 分布も広いために完全に、理想的に化学構造と分 **手量の分布を狭く制御することはできないが、木** 発明者等の研究によれば完全に理想的に狭い化学 構造と分子量の制御をせずとも、ピッチの構成成 分それぞれの化学構造特性と分子量が、ある好ま しい範囲内に存在し、かつそのような構成成分が ある好ましい範囲内の構成比率でバランスよく含 有されてピッチを構成するとき、十分構足される 分子配向性、均質性、および軟化点の光学的異方 性ピッチが得られることが分つた。

次に、このようなピッチ構成成分の化学構造特性と分子量の好ましい範囲、及び構成成分の構成

分、 A 成分に比べれば縮合多環芳香族の平面構造 がかなり発達し、その経際会合によつて分子配向 を作りやすい成分であり、C成分と相称して、光 学的異方性、すなわち分子配向の骨格を形成する 成分であり、また同時にO成分、A成分とも相称 して、可塑剤的作用も果たしこのB成分がさらに **重縮合が進むとC成分に変化すると推定されてい** る。B成分の特性として好ましいものは、C/H 賦予比が1.5~1.9、faが0.80~0. 95で、技迹の水影添加反応処理によつて、クロ ロホルムに100%可溶化し推定数平均分子量が 800~2,000、推定最高分子量が、10. 000以下であり、また、B 成分の構成比率とし ね介いで決まり、ピッチ全体の5~40重量分で ある。すなわち、この成分においてC/H原子比 または、faが上述の箱川より小さい場合、ある いはこの成分の構成比率が上述福州より小さい場 介は、ピッチの分子配向性が不十分となつて均質 な光学的異方性ピッチとはならないことが多く、

この場合、共存する C 成分の構成比率が十分に大きいときは、光学的異方性の均質ピッチとなるが、 軟化点が高い。また、推定数平均分子量、または推定 破高分子量が上述の 範囲より 大きい場合、または、B 成分の構成比率が上述の範囲より大きい場合は、均質な光学的異方性ピッチとなるとしても、軟化点が高くなりすぎて、紡糸が困難であり、これは木苑明の目的とするピッチではない。

C成分の構成比率として好ましい範別は、主とし てB成分とのかね合いでピッチ全体の25~65 重量%である。すなわち、C成分のC/H原子 比、あるいはfaが上述の範囲よりも小さい場 合、または、構成比率が上述の範囲より小さい場 合は、ピッチ全体の分子配向性が不十分となつ て、等力性部分をかなり含む不均貨ピッチとなる か、他の成分とのバランスによつては軟化点が高 いものとなる。また、技造の水業橋加反応によつ てもクロロホルムに完全には可能化されないよう なじ成分もあるが、このようなものは、分子なの 推定が不可能なほど非常に高分子型の場合多環芳 乔族化合物を含むか、又はカーポン等の不触物を 合むので不適当である。さらにこの水業抵加反応 を加えてクロロホルムに可溶化した後、誰定した C成分の推定数平均分子量または最高分子量が上 近の範囲より大きいような場合と、C底分の構成 比率が上述の範囲を越える場合は、ピッチ全体が 光学的異方性となるとしても飲化点が高く、従つ て高い紡糸温度を要するか、紡糸が不可能なこと

が多い。

木明細当でいうfa(芳香族構造炭素分率;芳香族構造に属する炭素原子の数の全炭素原子の数に対する比率)は、ピッチ成分は料の炭素と水素の含有率分析値と、赤外線吸収分光分析により加騰らの方法(燃料協会誌 55 244、(1976))に従って、次式によって計算されたものを川いる。

f a = 1 -
$$\frac{H/C}{2 \cdot (1 + 2 \cdot \frac{D_{3030}}{D_{2920}})}$$

H/C:水溝と炭渠の原子数比

D₃₀₃₀ / D₂₉₂₀ : 3 0 3 0 cm⁻¹ の 吸 光 仮 と 2 9 2 0 cm⁻¹ の 吸 光 仮 の 比

また木明細街でいう、数平均分子設は、クロロホルムを溶媒として一般的な手法である源気圧平衡法を用いて測定する。また分子登分布は、ピッチ以料を、クロロホルムを溶媒としてゲルバーミエーションクロマトグラフィで10ケの分子量区分に分取し、分取したそれぞれの区分の数平均分子量を、前述の蒸気圧平衡法で測定し、各区分の

部出容量と数平均分子量の関係で、このゲルバーミエーションクロマトグラフィーの検登線を作成し、これを用いて、各ピツチの各構成成分の分子量分布を測定した。この場合、溶出液の屈折率の変化がその重量濃度の変化にほど比例する。

上述の如き炭素質ピッチは、木発明に係る光学 的異方性炭素質ピッチの製造方法により極めて針 適に製造される。すなわち、本意明に従えば、重 質读化水素油、タールまたはピッチを出発飲料と して、その熱分解正縮合により、部分的に光学的 異力性相を生成せしめた後、光学的異方性相をを れ以上分子最を増大させることの少ない程度で批 様せしめて分離し、光学的異方性相が震縮された ピッチを得て、その後これを短時間無処理して光 学的異方性相を 9 0 %以上含有するピッチを製造 することができる。

糸力法について説明する。紡糸方法は、従来、使 川 されている方法を採用することができ、例え ば、下方に直径0.1mm~0.5mmの勘糸口 金を有する、金属製筋糸が器にピッチを蛋り込 み、不活性ガス雰囲気下で、280~370℃の 間の一定温度にピッチを保持して溶離状態に保つ て、不新性ガスの圧力を数100mmHgに上げ ると、口金より溶融ピッチが押出され流下するの で、その後下部の温度、雰囲気を調御しつつ、液 下したピッチ繊維を高速で回転するポピンに造取 るかまたは、災災させて、気流で引収りつつ下方 の集積槽の中へ集積する。この際、動糸容器への ピツチの供給を、予め解願したピツチを、ギアポ ンプなどで加圧供給すると退続的に紡糸すること が可能である。さらに上述の方法で、口企の近伤 で、一定に程度調御された高速で下降するガスで ピッチ繊維を延糸しつつ引取り、下方のベルトコ ンペア上に長級雑又は知識雑、あるいは相互に交 新したマット状のピッチ 繊維 不離 伯を作る方法も 川いうる。また、周號に紡糸口仓を有する円位状

性相の造版の小さい上層とおよそ分離して抜き出し、分離された下層の光学的男方性相合有平が70~90%であるピッチを、次に約380℃以上、好ましくは390℃~440℃でさらに短時間熱処理し、光学的異方性相合有率が90%以上の所望のピッチとすることができる。

次に、本発明に従つた製造法により得られた光学的異方性相合有率 9 0 %以上の光学的異方性ピッチを解離紡糸して得られたピッチ繊維および紡

の勧糸容器を高速で回転させ、これにお他ピッチを連続的に供給し、円筒紡糸器の阿堪より違心力で押し出され、回転の作用で延糸されるピッチ繊維を集積するような紡糸方法も用いられる。いずれの方法においても、本発明のピッチを用いるときは新職状態であり紡糸をするのに好適な程度(紡糸機中での最高温度)が、280~370での範囲と、従来よりも低いことが特徴であり、従って紡糸工程での熱分解や無重合が極めて少なく、その結果紡糸後のピッチ繊維は、紡糸前のピッチ組成物とほとんど同じ組成物であることが特徴である。

すなわち、このようにして得られた炭素質ピッニチ繊維は、その繊維輸方向の断面を研究して傷光 類数 鏡で 観察 すると、 全面 が 光学的 異方性 で あり、 しかも、 繊維輸 方向 へ配向 していること および繊維 無と直角方向の断面をみると、ほとんど 等 方性 ないしは、 極めて微細 な 異方性部分がモザイク状に ランダムに集合していることが認められる。この 現象は、 恐らくは、 本発明に従って刻造 したピッチが特に O 成分、 A 成分 という流動性の大きな成分をバランスよく合有されている場合には紡糸過程で繊維動方向にはよく分子配向し、 級維動に直角方向には比較的自由に 柔軟に分子配向しうることが起因していると思われる。また、 当該ピッチ機 雑 を 粉砕し、 石 機 形 剤 を 使 用 して O 成分、 A 成分、 B 成 分 および C 成分 に 分別して 分析すると、 紡糸前の ピッチの組成 および特性とほぼ 回一の値が得られる。

従来の光学的異方性ピッチの場合、少なくとも 紡糸線中のある部分で380~430℃といつた 高温で溶験状態を保ち紡糸を行なうことが実態で あり、この場合無分解や無重合が顕著に起ること から紡糸後のピッチ線維の組成構造は、紡糸前の ピッチより後化の進んだものとなることが多い。

このように、本発明の製造法に従って製造され、 Llつ特に本発明の製造法にて製造されたピッチが特定の構成成分と組成を有している場合には、断るピッチから製造されたピッチ繊維は、紡糸前のピッチと物質組成としてはほとんど変らな

尖施例 1

石油の接触分解で誕生するタール状物質を存圧に換算して450℃まで減圧機器して得た炭素合作平90.0℃まで減圧機器して得た炭素合作平90.0℃のタールを出地ボ1.0000gェを内容積1.4500円を出発を設計とした。以料1.000gェを内容積1.450のステンレス製反応装置に張込み、電影ガス気流下で十分慢性しながら4.15℃に保つて2.5時間熱分解形縮合反応に供し、残器ピッチ

いので、もし動糸工程で何らかの放解があつてピッチ繊維として品質管理限界以下のものが製造された場合、これを再解歴して用いることができるという利点がある。

本意明に従って製造された光学的異方性ピッチ は、光子異方性相を90~100%合有する実質 上均貫なピツチであるにも拘らず、幅めて低い数 化点(320℃以下)を有するから、十分に低い お融紡糸温度(380℃以下、ふつう実施振猛と しては300~360℃) で紡糸することができ る。従つて、次の利点が得られる。すなわち、① 熱分解重縮合の顕著な温度より十分低い温度で紡 糸することができ、また、均貫なピッチであるか ら、ピッチの勧糸性(糸切れ、糸の細さ、糸径の 均一さ)が良好であり、紡糸工程の生産性が向上 する。さらに、紡糸中のピッチの姿質が生じない ため、製品炭素繊維の品質が安定であること、の 紡糸中の分解ガスの発生および不働物の発生が極 めて少ないから、紡糸されたピッチ繊維の欠陥 (気他または掲形異物粒子の含有)が少なく、製

として軟化点187℃、比重1、32、キノリン 不裕分7、9wt%で、偏光顕微鏡で観察すると 光学的等方性の母相中に直径が100μm以下の 直球状の光学的異方性球体を約40%含むピッチ が、以料に対して17.0wt%の収率で得られ た。次にこのピッチ100、0g r を約300 m 2 の円 筒型ガラス製 容器にとり、 空楽雰囲気下 3 60℃で30分間、攪拌せずに保持し、次にこれ を放ねし、ガラス製料器を破壊してピッチをとり 出した。このピッチは肉眼でも上層と下層が分離 していることが、その光沢のちがいから辺めら れ、上層のピッチ塊と下層のピッチ塊をはく難し て分別することができ、下層ピッチは約32g チは直径が50μ四以下の光学的異方性球を約1 5%含む大部分が光学的等方性のピッチであり、 下層ピッチは、50μ皿程度の直径の光学的等方 性の球を約20%含む大部分が光学的異方性のピ ツチ、すなわち約80%の光学的異方性相の含有 4を示すピッチであつた。次にこの下沿ピッチを

5 0 m 2 の ガ ラ ス 製 ぎ 器 に 入 れ 限 作 し つ つ 4 0 0 で で 3 0 分 間 然 処 理 し て 約 3 0 8 г . の ピ ッ チ を 得 た。 こ の ピ ッ チ の 秋 化 点 を 測 定 す る と 、 2 5 7 で で あ り そ の 光 学 的 異 力 性 相 の 含 有 平 は 約 9 5 % 以 上 で あ つ た。 次 に こ の ピ ッ チ の a - ヘ ブ タ ン 可 部 化 (0 成 分) およ び ュ - ヘ ブ タ ン 不 部 で ベ ン ゼ ン 可 部 の 成 分 (A 成 分) を 定 量 す る と 、 0 成 分 が 1 0 . 1 ▼ t %、 A 成 分 が 2 9 . 6 ▼ t % も 含 有 され る こ と が 辺 め られ た。 は ピ ッ チ の 残 余 は ベ ン ゼ ン 不 部 広 分 で あ つ た。

次に、このピッチを、直径 0 . 5 mmのノズルを介する紡糸器に充塡し、3 4 0 ℃でお絵し、1 0 0 mmHgの窓楽圧で押出し、高速で回転するポピンに造取つて紡糸したところ 5 0 0 m / 分の引取り速度でほとんど糸切れなく、繊維径 8 ~ 1 2 μmのピッチ繊維が得られた。このピッチ繊維の一部を、酸楽雰囲気中 2 3 0 ℃で 1 時間保持し、次に窒素ガス中で 3 0 ℃ / 分の 外温速度で1 、5 0 0 ℃迄加熱して、すぐ放冷し、炭素繊維を引たところこの炭素繊維の引張り強度は約3 G

と380で以下の温度では非常に紡糸が困難であたが、390~410でで一応紡糸が可能であるこれが可能であるののエグ・おから白煙を生じやすく、また機径は15~18μμに1回ととの糸切れを生じ、また機径は15~18μμをのた。ここで得られたピッチ繊維の一部を定化を引したとのではたいで、引きを開いて、引きを開いて、引きを開いて、引きを発したところ前者は約1・2GPa、接近は10zGPaでは分)、およびか14・2 wt %であった。

尖施例 2

石油の接触分解で調生するタール状物質を常距に換算して450℃まで装圧蒸溜して得た炭素含有率89.4 wt %、水素含有率8.9 wt %、 比低1.08、キノリン不能分0%のタールを出発原料とした。原料1,000gr.を内容積 Pa、引展りが作取は約2、2×10² GPaを ²1 た

また、ピッチ繊維の規部よりLgrをとり、nーへプタン可称成分(O成分)とnーへプタン不能かつベンゼン可称の成分(A成分)を定量したところ、O成分は8.9w t %、A成分は29.8w t %であつた。

H: 40 66 1

実施例 1 と同じタールを出免飲料として、その1、0000grを内容被1、452のステンレス製反応装置に張り込み、電業ガス気流下で十分機作しながら415℃に保つて5時間、熱分解玉紹介反応に供し、残留ピッチとして軟化点312℃、比重1、36、キノリン不部分60%のピッチを110gr、切た。このピッチを観光顕微鏡で観察すると直径が約50μ皿以下の光学的等方性の球体をところどころに含む、ほとんど全体が光学的異方性のピッチ、すなわち光学的異方性和が約95%以上のピッチであつた。

このピッチを実施例1と同じ紡糸器で紡糸する

1、450のステンレス製反応装置に畳込み、窒 最ガス気旋下で、十分攪拌しながら、440℃に 保つて1時間熱分解重縮合反応に供し、残器ピッ チとして、飲化点220℃、比重1.33、キノ リン不溶分(C成分)14wt%で、偏光顕微鏡 で観察すると、光学的等方性の母和中に、直径が 200μ皿以下の資味状の光学的異方性珠体を約 60%含むピッチが、原料に対して22wt%の 収率で得られた。次にこのピッチを下船に抜き出 し川バルブを備えた内径4cm、及さ70cmの 門筒形容器にとり、窒素雰囲気下で毎分15回転 で攪拌しつつ、380℃で30分間保持した後、 製表加圧下100mmHgで容器の下部パルブを 聞き、やら精製な下層のピッチを、静かに流下さ せ、劉嘉ガスを疏通してある容器に循環した。こ のようにして流下するピッチの粘度が顕著に低下 するまで抜き取つたピッチを下層ピッチと呼びそ の収率は最込量に対し約38mt%であった。さ らに容器に残つた上層のピッチを旋出させ別に崩 **歩したピッチをと増ピッチと呼びその収率は、愛**

特開昭62-181391 (13)

込量に対して約61wヒ%であつた。 ヒ歴ピッチ は主として直径が20m以下の瓦除状の光学的異 力性相小球体を約20%含む大部分は光学的等方 性相のピッチであり、軟化点195℃、比重1. 31、C成分约4 W t %. B成分约 3 8 W t %. A 成分約36 w t %、 O 成分約22 w t %のピッ チであつた。一方下層ピッチは、等方性相を15。 ~ 20%但含する大部分は火きな流れ模様をもつ た光学的異方性相から成り、その軟化点は252 TC. 比亚1.35、C成分约21 W 1%、B成分 约37 w t % A 成分约33 w t % . O 成分约9 w t % のピッチであつた。次にこの下層ピッチ をさらに250mlの反応容器中で容異雰囲気下 で十分提择しつつ390℃で約30分間無処理し て得られたピッチを試料2、約50分間無処理し て得られたピツチを放料」とすると、試料1は盤 光顕微鏡の観察によつて、全て光学的異方性相で あり、約260℃の軟化点、試料2はまた約5% の光学的等方性相を微小球状に包含する大部分が 光学等方性相のピッチで、軟化点は257℃であ

つた。次にこれら試料1と2を新聞分離分析によって0成分、A成分、B成分、C成分に分離しその別成比と、各成分のC/H原子比、fa、数平均分子量最低、および最高分子量を測定した。その結果を第1表に示した。

また試料1 および2 のピッチを、直径0 . 5 mmのノズルを打する紡糸器に充塡し、3 5 0 で近傍の温度で解歴し、2 0 0 mm H g 以下の電素圧で押出し、高速で回転するポピンに造取つて紡糸したところいずれのピッチも5 0 0 m / 分の高速で、糸切れも少なく繊維径の5~1 0 μmのピッチ繊維を長時間にわたつて紡糸することができた。その結果を第 2 表に示した。

比較例 2

実施例2と同じタールを出発原料とした。原料1、0000grを内容積1、452の無処理装置に張り込み、室装ガス気旋下で十分攪拌しながら430℃で1、5時間無処理し、軟化点217℃、比近1、33、キノリン不溶分(C成分)13wt%で、偏光顕微鏡で吸激すると、光学的等

次に、この試料を実施例2と同様の操作で溶剤分離し各域分の含有量および特性値を求め、その結果を第1要に示した。さらに、この試料を実施例2と同様に紡糸したところ、500m/分でも糸切れ頻度が多く、また、繊維太さの狙いピッチ機能は得られなかつた。結果を第2要に示した。

加 1 表 光学的異力性ピッチおよび構成成分の特性

	ピッチ全体の性状		ピッチ構成成分の性状							
ピッチ	秋 化 点 (°C)	光学的吳方性相合有量(%)	構成成分	含有量 (wt%)	C/H 原子比	f a.	数平均分子位 (VPO)	破低分子位 (GPC)	最高分子能 (GPC)	
	260	100	〇成分	6	1.38	0.84	415	175	-	
(本 危 明)			A "	24	1.47	0.86	515	-	2040	
			В //	27	1.71	0.87	1130	-	7200	
			C //	43	1.90	0.92	1850	-	19000	
以料2	257	. 95	O成分	. 9	1.37	0.83	412	185	-	
(木発明)			A "	25	1.47	0.86	505	-	1970	
		•	В //	24	1.71	0.87	1130	- .	7200	
			C "	42	1.90	0.91	1880	<u>-</u>	18500	
武料 3	217	80	〇成分	7	1.35	0.83	388	185	-	
(比較)			A "	44	1.48	0.86	470	· -	1730	
			В ″	36	1.70	0.87	1080	-	6800	
			C "	13	1.89	0.90	1810	-	15500	
	1		•							

第2表 光学的異方性ピッチの紡糸特性

	勘糸前の		勘糸条件			*糸切れ頻度	繊維の	紡糸後の	
	ピッチの						太さ	ピッチの性状	
ピッチ	軟化点	C成分	温度	速度	紡糸時間		平均值	秋化点 C成分	
HA	(%)	(W t %)	(°C)	(2/介)	(分)	(回/10分)	(µ)	(%)	(Wt%)
武科 1	260	4 3	350	500	1 0	1 以下	7 . 8	_	_
(本発明)					8 0	"	8.7	_	_
					0 8 1	"	8 . 6	263	4.4
試料 2	257	4 2	345	500	10	1 以下	6 . 8		_
(水疮明)。					6.0.	. "	8.8	-	_
					1 2 0	"	10.5	262	4 5
武村 3	217	1 3	343	300	1 0	20以止	15.3		
(比較)		•			8 0	"	17. i	227	17

手 鏡 補 正 3 (方式)

图和62年2月26日

特許扩展官

黑 田 明 雄 瞬

事件の表示 関和61年特許顯示203967号

発明の名称 光学的異方性炭素質ピッチの製造法

補正をする弁 事件との関係

特許出願人

住 济

東京都千代田区一ツ橋一丁目一番一号 東亜燃料工業株式会社

4 称

作理人 住 所

郵便番号 105

型流体区新橋5丁目14番2号 鈴工ビル (電話 459-8309)

氐 名

(7563) 弁理士 倉 橋

補正命令の目付 昭和62年1月27日(発送日)

制正の対象 明細書(3頁~51頁)

相正の内容 別紙の辿り 「顕書に成初に続付した明細書(3頁~51頁)の作書(内 客に変更なし)」